題 (4) (特許法第38 既ただし留) の規定による特許出國)

昭和49年 4 月.18日

特許 庁長官 斎藤英雄 殿

- 芳香族アミドカルポン酸の製法 発明の名称
- 特許許求の範囲に記載された発明の数
- 2.

BB県東筑摩郡本郷村大字横田436番地の1

耕三郎 (ほか1名)

ツセイ薬品工業株式会社 휬 代表者

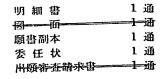
理 代

〒104 東京都中央区銀座6丁目4番5号 土壌ビル5階 明

形

話 (571) 9920 番

添付書類の目録



49-043676



方案 (113) 19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51 - 1439

昭51. (1976) 1.8 43公開日

②1)特願昭 49-43676

昭49. (1974) 4.18 22出願日

審査請求 未請求 (全12頁)

庁内整理番号 6855 44 7169 44 7330 43 5629 44 7043 44

62日本分類

16 C64 D/ DYZ E38

E41 2 行刑禁

51) Int. C1².

C076103/78 C077317/601 A 61K 31/195 A61K 31/22 A61K 21/26 C070309/12

細

発測の名称

芳香族アミドカルボン酸の製法

- 特許請求の範囲
 - 一般式 (1)

$$(X)_{n} = \begin{bmatrix} R_{5} & R_{4} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{1} & R_{2} \end{bmatrix}$$
 oy (1)

(式中のR1とR2はそれぞれ水溶原子または低級 アルキル基であり、R3とR4はそれぞれ水素原子 または低級アルキル基であるか、あるいは両者で 化学結合を形成するものであり、異はハロゲン原 子、水浚基、低級アシルオキシ基、直頭状または 分枝状の低級アルキル、低級アルケニル、低級ア ルコキシまたは低級アルケニルオキシ基あるいは 選状アルキル菇であり、¥は水果原子またはアル カリ金属であり、nは答または1~3の密数であ b、 Xが 2 個の低級アルキル、低級アルケニル、 低級アルコキシまたは低級アルケニルオキシ基で ある場合は両者が結合して堰を形波することがで きる)

で表わされる芳香族アミド誘導体と、一般式 2 - アルキレン - COOR5

(式中の2は酸残基であり、アルキレンは直鎖状 または分枝状のアルキレン基であり、 R5 は水素 原子または炭化水素基、置換炭化水素基および環 状エーテル基の中から選ばれるカルボキシル基の 保護基である)

で表わされる脂肪族カルポン酸またはそのエス テルとを反応させ、所望に応じその生成物を塩に 変えることを特徴とする一般式

$$(X) = \begin{cases} R_3 & R_4 \\ C - C - CONH \\ R_1 & R_2 \end{cases}$$

$$(B)$$

(式中の R₁,R₂,R₅,R₄,R₅,X,n およびアルキレン は前記と同じ意味をもつ)

て袋わされる芳香族アミドカルボン鍛またはそ のエステルまたはその塩の製造方法。

で扱わされる芳香族アミド誘導体と、一般式 2 - アルキレン - COOR5 (I) (式中の 2 は酸残基であり、アルキレンは直鎖状

-3-

これまで抗原抗体反応により激起されるケミカルメジェーターの遊離を抑制する抗アレルギー剤 ししてはジンシウムクロモグリケートが知られているが、このもの経口投与では全く薬効が期待できないため、その利用分野に制限があつた。したがつて経口投与によつても十分治療効果を発揮できる医薬品の出現がこの分野における重要を課題となつていた。

本説明により得られる新規な芳香族アミドカルボン 敬誘導体は経口投与によりアレルギー性疾患を治療しうる有用な化合物である。

本発明の目的化合物は、一般式

$$(X) = \begin{cases} R_5 R_4 \\ \vdots \\ C - C - C \cdot O N H \\ \vdots \\ R_1 R_2 \end{cases} = 0 - 7 n + V - COOR_5$$

(式中の R_1 と R_2 はそれぞれ水衆原子または低級アルキル基、 R_5 と R_4 はそれぞれ水衆原子または低級アルキル基であるか、あるいは両者で化学結合を形成するものであり、 R_5 は水衆原子または炭化水衆

特勝 昭51-1439(2) または分枝状のアルキレン基であり、Rs は水梁原子または炭化水素基、磁換炭化水素素および環状エーテル基の中から退ばれるカルボキシル基の保護基である)

で表わされる脂肪族カルボン激またはそのエステルとを反応させ、次いで常法に従いカルボキシル素の保護基を脱離させ、さらに所望に応じその 生成物を塩に変えることを特徴とする

一般式

$$(X) = \begin{pmatrix} R_{3} & R_{4} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{1} & R_{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_{3} & R_{4} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{1} & R_{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B' \end{pmatrix}$$

(式中の R₁, R₂, R₃, R₄, X, n およびアルキレン は前紀と同じ意味をもつ)

て表わされる芳香族アミドカルボン酸またはそ の塩の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は楽理作用を有する新規な芳行族アミッカルボン酸誘導体の製造方法に関するものである。

-4-

で表わされる芳香族アミドカルボン酸、そのエステルまたはその塩であり、これらはいずれも文献未載の新規化合物である。

本発明に従えば、

一般式

$$(X)_{\Pi} = \begin{bmatrix} R_{3} & R_{4} \\ I & I \\ C & C & C & O & O & N & H \\ I & I & I \\ R_{1} & R_{2} \end{bmatrix}$$
 OY (1)

- 5 -

(式中の R、と R2 はそれぞれ水溶原子または低級 で表わされる脂肪族カルボン酸またはそのエスアレキル落であり、 Rs と R4 はそれぞれ水溶原子 デルとを反応させ、所望に応じ常法を用いてカルまたは低級アルキル落であるか、あるいは両者で ボキシル基の保護基を脱離させ、またその生成物化学結合を形成するものであり、 X はハロゲン原 を塩に変えることにより、目的化合物を得ることで、水酸基、低級アンルオキシ基、直鎖状または ができる。 本発明において出発原料として用いられる前配

本発明において出発原料として用いられる前記 一般式 (I) の芳香族アミド誘導体は新規化合物で あり、たとえば一般式

特別 昭51-1439 (3)

(式中の R₁, R₂, R₃, R₄, X および n は前記と同じ意味をもつ)

で表わされる芳香族カルボン酸またはその反応 性官能的誘導体と、一般式

- 8 -

で表わされる芳香族アミド誘導体と、一般式 2-アルキレン-COOR。 (1)

(式中の2は酸残基であり、アルキレンは直鎖 状または分枝状のアルキレン基であり、R5 は水 素原子または炭化水素基、置換炭化水素基 および 選状エーテル基の中から選ばれるカルボキシル基 の保護基である)

-7-

で表わされるアミノフェノールとを反応させると とにより製造することができる。

たとえば前記一般式(N)の芳香族カルボン酸の 反応性官能的誘導体として酸クロリドを用い、と れを一般式(V)のアミノフェノールと反応させる 場合には、不活性溶媒中、塩基性物質の存在下で 両者を接触させ、所要時間加熱反応させ、反応混 合物を減圧下避縮し、残留物を水中に注ぎ、次い で鉱酸を加えて嫩性とし、析出した結晶を口別し、 適当な溶媒より再結晶するととにより、容易に前 記一般式(I)の化合物を製造することができる。 この際用いる不活性容媒としてはクコロホルム、 メチレンクロリド、アセトン、ペンゼン、トルエ ン、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメチル ホルムアミドなどが適当である。塩基性物質とし てはトリエチルアミン、ピリジン、 N,N - ジメチ ルアニリンなどの有破事三塩基や、炭酸ナトリウ ム、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水 **岩カリウムなどの無吸塩基が用いられる。**

一般式(11)で装わされる出発原科としては、ハ

本発明におけるフェノール性水酸基のアルキル 化反応は、それ自体公知の方法を用いて行をうと とができる。

本発明方法を好適に実施するには一般式(I)の化合物を基準として10~50倍量のメチルエチルケトンに1~5倍モルの無水炭酸カリウムを懸満し、これに一般式(I)の化合物と一般式(I)の化合物を加え加熱遠流下3時間から12時間反応させる。反応生成物を口過後、口液を濃縮し残留

-11-

$$(X)_{n} = \begin{bmatrix} -C = C - C & 0 & N & H \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{1} & R_{2} & 0 - T \\ R_{2} & 0 - T \\ \end{pmatrix}$$

(式中 R₁, R₂, R₅, X, n およびアルキレンは前記と同じ意味をもつ)

で表わされる化合物を製造し、次いでこれを還元 してもよい。

得られた化合物(m)のカルボキシ基は常法に従い返薬品として許容できる塩とすることができる。たとえば、化合物(m)のアルコール溶液にこれと当量のカセイソータの水溶液を加え適当な時間加温することにより、容易にナトリウム塩とすることができる。また、一般式(II)のエステルを出発原料として用いるときはその加水分解の操作により塩をつくることができる。

本発明によつて得られる芳香族アミド誘導体は抗原抗体反応によつて惹起される効果に対して特別の作用を有している。すなわち、アレルギーに起因する疾患の治療薬として広く使用することができる。

特別 昭51-1439 (4)

物を酸、塩基で処理し、必要あればエスチル基を常法に従つて除去し、塩酸で吸性とし折出した結晶を口取し適当な有限容楽から再結晶し目的物を 供る。

本発明方法においては、一般式(I) で表わされる出発原料中のYが水素原子であるものの代りに、Yがアルカリ金属のものすなわちフェノラートを用いることができる。このフェノラートは反応中に生成させてもよい。

本発明の目的化合物の中のヒドロケイ皮酸誘導体、すなわち一般式

(式中の R₁, R₂, R₅, X , n および アルキレンは 前配と同じ意味をもつ)

で表わされる化合物を製造する場合は、対応する 出発原科を用いて直接に製造してもよいし、また 最初に対応するケイ皮破誘導体、すなわち一般式

~12-

次に実施例によつて本発明をさらに詳細に説明 する。なお、各実施例中における生成物の激点は いずれも未補正である。

参考例

ジオキサン 1 0 0 ml とピリジン 1 0 ml との混合物中に、3 ・4 - ジメトキシケイ皮酸クロリド 2 3 9 と 3 - アミノフエノール 1.1 9 とを加え、2 時間加熱環流させる。次いで反応混合物を減圧下に緩縮し、残留物を少量のエタノールに溶かして氷水中に注ぎ、塩酸により酸性にすると、結晶が折出してくる。これを口別し、エタノールと水の混合物より再結晶させることにより、融点 21.1 ~ 2 1 4 ℃の N - (3 - ヒドロキシフエニル) - 3′・4′-ジメトキシケイ皮酸アミド 1.8 9 を得た。

同じより にして、 対応する出発原料を 用い次の 化合物を 製造することができた。

$$(X)_{n_{4'}}^{5'} \xrightarrow{(1)^{5'}}_{6'} \xrightarrow{R_5}_{1} \xrightarrow{R_4}_{1} - CONH$$

											•	44.1	州 1051—1405 (5)
	n	x	R,	1	R 2	· F	₹,	. R ₄	水酸基の位置		濃	点包	再結晶俗碟
	2	3' -OMe , 4' -OMe	Н	i	H		詩	合	3	2	, ,	~=14	含水アシコール
	2	3 —ОМа , 4 —ОМе	H	ļ	Н	į	结	合	2	,	3 3	~/38	含水アルコール
	2	J -OMe . 4 -OMe	Мө	:	H	:	is	合	. 4	1	9 7	~200	含水アルコール
!	.2	3' -OMe , 4' -O·n-Pr	н		H	i	锆	合	2	/	4 5	~147	含水アルコール
	1	4 ' - 1-pr	H		H	,	诘	合	2	1	6 /	~163	含水アルコール
i	,	<i>Ψ'</i> − Me	н		н	1	洁	合	4	2	5 /	~255	含水アルコール
	,	<i>4</i> ⁴ − Me	H		Н		н,	Н	4	1	9 2	~ 195	含水アルコール
	/	≓ − C1	н	;	H	i	喆	合	4	2	2 2	~225	含水アルコール
	/		н		H		讨	合	2	2	15	~216.5	含水アルコール
	.2	3.4-メチレンシオキシ	H	ı	e k		结	今	4	/	5 3	~155	含水アルコール
	/	ビーシクコヘキシル	н		н	;	i.	合	4	z	5 4	~256	含水アルコール
:	ã	3', 4'ートリメチレン	Н	•	H	,	結	合	4	2	38	~243	含水アルコール
:	2	3' - OMe , 4' - OMe	H		H		н.	н	2	1	3 3	~/35	含水アルコール
į	2	3'- OMe , 4'- OMe	H		H	i	結	合	4	1	8 4	~/89	含水アルコール
:	3	ヹ , ヸ, ぢートリメトキシ	H		H		結	合	. 4	1	00	~105	含水アルコール
٠	/	$4' - OCH_2C(CH_5) = CH_2$	Н		H	,	結	合	4	/	8 8	~/92	含水アルコール
	/	4'-OCH2CH=CH2	н		H	,	許	合	4	2	0.1	~205	含水アルコール
	2	J-CH2CH=CH2, 4-OH	н		H	:	浩	合	4	/	9 5	~200	含水アルコール
	2	$3'-CH_2C(CH_5)=CH_2$, $4'-OH$	н		H	÷	ř.	合	4	2	0 7	~2/2	含水アルコール
÷	0	·	мө		H	,	結	合	4	1	8 2	~ 1.84	含水アルコール
į	0		H		ᅿ	ź	洁	合	4	2.	10	~2/5	含水アルコール
:	/	# - Cl	ωе		H	÷	洁	合	4 .	/	8 8	~/9/	含水アルコール
	1	u' — OM⊕	M B		H	ř	佶	合	. 4	1	6 4	~170	含水アルコール
٠	2	4'-000CH5, 3'-0Me	н		Н	į	結	合	3		9 3	96	含水アルコール
İ	2	J'-CH2CH=CH2, 4'-OM9	H	1	н	i	洁	今		/	4. 8	~/52	含水アルコール
	2	J-CH ₂ C(CH ₅)=CH ₂ . 4'-OMe	H		H	i i	待	合	#	/	6 3	1~166	含水アルコール

-15-

実施例 /

サー(ザーメチルシンナモイルアミノ)-フェノール 1.39、ヨウ化ナトリウム 0.89、αープロムプロピオン酸エチル 0.99をメチルエチルケトン 50 ml に容解し、無水炭酸カリウム 0.89を加えてかきまぜながら 20時間加熱 遺流する。

反応液を冷却後口過し口液を澱縮する。残留物を10%水酸化ナトリウム水溶液10ml、エタノール10ml中で加温し加水分解する。

反応液を氷ー塩酸中に注ぐと結晶が析出する。 結晶をロ取し含水アルコールより再結晶しαー〔 4ー(4ーメチルシンナモイルアミノ)フェノキ シ〕プロピオン酸 0.3 9 を得る。融点 2 0 0 ~ 2 0 4 C。このものの特性を以下に示す。

赤外線吸収スペクトル(KBr)

VCO /725, /655cm-1

元素分析値 C19H19O4Nとして

C H N 実測値 70・/4 5・89 4・3/ 計算値 70・28 5・96 4・/4 核磁気共鳴スペクトル (d6-DMSO,90MHZ)

δ 1.35 (d, 3H, メチル基水紧)

2.33 (B, 3H, 芳香堰置換メチル基水紫)

3.15 (q, 1H, メチン基水索)

6.19~9.18 (m,10H, オレフイン,芳香環水素)

10.7 (8.14,カルボン酸水素)

このようにして得たα-〔«-(«-メチルシンナモイルアミノ)フェノキシ〕プロピオン酸をアルコールに溶解し、これと当量の水酸化ナトリウムを加え30分間加温する。波圧下で濃縮し、残留物を少量のアルコールに溶かし、エーテルを加える。 忻出する結晶をロ取しα-〔«-(«-メチルシンナモイルアミノ)フェノキシ〕プロピオン酸のナトリウム塩を得る。

実施例 4

ュー(ゔ・ザージメトキシンンナモイルアミノ).フェノール / 8、ヨウ化ナトリウム 0.5 9、プロム酢酸エチル 0.5 5 9 をメチルエチルケトン 5 0 ml に溶解し、無水炭酸カリウム 0.5 9 を加えてかきまぜなが 5 4 0 時間加熱 激流する。 反応液を冷

特別 昭51-1439 (6)

却後ロ過し、ロ液を機縮すると黄色油状物が得られる。このものに / 0 多水酸化ナトリウム水溶液中で加温し加水分解し次いで反応液を氷水中に注ぎ塩酸で酸性とする。 析出結晶をロ取し含水アルコールより再結晶するとユー(ゴ・ザージメトキシシンナモイルアミノ) フエノキシ酢酸 0.79を得る。 破点 / 68~/ 70℃。 このものの他の特性を以下に示す。

赤外線扱収スペクトル(KBr)

ν_{CO} /735, /650cm⁻¹

元素分析値 C19H19O6N として

C H N

計算值 63.96 5.43 3.74

返測値 63.86 5.36 3.92

-18-

核磁気共鳴スペクトル (d6-DMSO,90MHZ)

8 3.80.3.82 (B.B. 3H. 3H. メトキシ基水素)

4.80 (B. 2H, メチレン基水素)

6.90~8.30 (m, 9H, オレフイン芳香塩水紫)

9.2 (B, /H, カルボン酸水素)

とのようにして得た ユー (ず・ ザージメトキシシンナモイルアミノ) フェノキシ酢酸をアルコール溶液に溶解し、とれと当重の水酸化ナトリウムを加え 3 0 分間加温する。 減圧下で凝縮し、残留物にエタノールを加え溶解しこれにエーテルを加え、折出する結晶を口取しュー(ず・ザージメトキシシンナモイルアミノ) フェノキシ酢酸のナトリウム塩を得る。

実施例3

前記参考例で得た化合物を原料として用い、前記各実施例と同様の操作により、以下の化合物を製造することができた。

$$(X)_{n} = \begin{bmatrix} R_{5} & R_{4} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{1} & R_{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{5} & R_{4} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{1} & R_{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{5} & R_{4} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{1} & R_{2} \end{bmatrix}$$

-19-

							t	
n	x .	R,	R ₂	R ₅ , R ₄	! アルキレン .	洁合位徵	融 点 (12)	再結晶溶媒 :
2	3-048 . w-0Me	н	н	結合	-CH2-	3	160~165	含水アルコール
2		Ме	' н	'結合		4	165~168	含水アルコール
2	J-OMe , #-O·n-Pr	H	н	結 合		2	96~ 99	含水アルコール
; /	φ' – i-Pr	H	· H	結合	,	2	148~152	含水アルコール
' <i>;</i> .	φ' - Me	Н	н	н, н	,	4	/88~/89	含水アルコール
7	2 - C1	н	н	结 合	•	.2	182~187	含水アルコール
2	J, 4 - メチレンジオキシ	н	Мө	結 合		4	167~170	含水アルコール
,	 ダーシクロヘキシル	H	Н	钻 合	•	4	224~226	含水アルコール
2	·····································	Ħ	н	钻 合	. "	4	190~195	含水アルコール
2	J - OMe , 4 - OMe	: н	н	н'. н	"	· 2	117~120	含水アルコール
3	ヹ. 4. 5ートリメトキシ	H	н	結 合	•	4	2/3~2/8	含水アルコール
, _	4' - OCH 2 C(Me)=CH2	Ĥ	н	褚 合		4 ·	197~199	含水アルコール
/	4 - OCH 2 CH=CH2	Н	H	箱 合	•	4	2/3~2/6	含水アルコール
2	J-CH2CH=CH2.4-OMe	H	н	結 合	,	4	197~201	含水アルコール
.2	J- CH2C(Me)=CH2, 4'-OMe	H	н	趋 含	•	.4	157~160	含水アルコール
0		н	н	結 合	*	4	185~190	含水アルコール
	φ' − C1	Мө	. н	結 合	•	4	2/5~2/7	含水アルコール
-/	α' — ΟΜΘ	Мө	н	結 合		4	111~119	含水アルコール
2	4' - OCOCH ₅ , 3' - OMe	н	н	結 合		3	· 15~ 17	含水アルコール
. 2	<i>J</i> – ΟΜε , ψ' – ΟΜε	. н	' н	結 合	-(CH ₂) ₃	4	185~190.	含水アルコール .
: ;-		, H	В	路 合	-(OH ₂) ₅ -	4	173~176	含水アルコール
2	3'-0 Me , 4'-0Me	н	H	結 合	-CH(CH ₅)-	3	198~203	含水アルコール
2	3-0Me, 4-0H	н	н	, 結 合	-CH2-	3	183~185	含水アルコール

-20-

4 前記以外の発明者

長野県岡谷市湊10番地の4

長野県松本市笹部南原1128番地の1

タ 吹

マフ ミト コトブキグイ 長野県松本市寿台 2 丁目 9 番 2 号

が一直

長野県松本市大字島立1,712番地

*

長野界塩尻市大字広丘吉田 2,5 2 5番地

『ナジブペ トヨジナマラ 『ナジオタカ 長野県南安曇郡豊科町大字南穂高 2,6 0 4番地

小林

マッチト コトプチャプキンプ 長野県松本市大字寿白瀬淵 6 8 1 番地 8 3

藤 かかけ

7.補正の内容 明細書の沖書(内容に重更なし) 下記のページについてポールペン斟部分を別 紙のとおり訂正します。

- (j) 第1ページ~第6ページ
- (前) 第8ページ
- (iii) 第10ページ
- (V) 第12ページ~第14ページ
- W) 第19ページ~第20ページ

特問 昭51-1439 (7) 手 続 補 正 曹(方式)

昭和49年 9月18日

特許庁長官 斎 藤 英 雄 邸 特許庁審査官



- 1 事件の表示 昭和49年特顯第 43676 号
- 2 発明の名称

芳香族アミドカルポン酸の製法

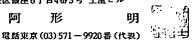
3 補正をする者 特許出願人 長野県松本市芳川区野湖105番地 キッセイ薬品工業株式会社

> 代表者 神沢邦雄

4 代理人

東京都中央区銀座6丁目4番5号 土屋ビル

(7182)明



- 昭和49年 8月10日 5 補正命令の日付 (発送日:昭和49年8月27日)許庁
- 明細書の発明の名称の欄、特許請求の 2 0 19 6 補正の対象 範囲の欄および発明の詳細な説明の欄。

1. 発明の名称

・芳香族アミドカルポン酸の製法

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 一般式 ·

$$(X)_{n} = \begin{bmatrix} R_{3} & R_{4} \\ 1 & 1 \\ C - C - CONH \\ 1 & 1 \\ R_{1} & R_{2} \end{bmatrix}$$
 OY (I)

(式中のR, とR, はそれぞれ水素原子または低級 アルキル基であり、R3とR4はそれぞれ水衆原子 または低級アルキル基であるか、あるいは両者で 化学結合を形成するものであり、×はハロゲン原 子、水酸基、低級アシルオキシ基、直鎖状または 分枝状の低級アルキル、低級アルケニル、低級ア ルコキシまたは低級アルケニルオキシ基あるいは 環状アルキル基であり、Yは水素原子またはアル カリ金属であり、 n は零または 1 ~ 3 の整数であ り、Xが2個の低級アルキル、低級アルケニル、 低級アルコキシまたは低級アルケニルオキシ基で ある場合は両者が結合して環を形成することがで きる)

で表わされる芳香族アミド誘導体と、一般式 Z-アルキレン- COOR。 (1)

(式中の Z は酸残基であり、アルキレンは直鎖状または分枝状のアルキレン基であり、 R₅ は水岩原子または炭化水素基、置換炭化水素基および環状エーテル基の中から選ばれるカルボキンル基の保護基である)

て表わされる脂肪族カルポン酸またはそのエス テルとを反応させ、所望に応じその生成物を塩に 変えることを特徴とする一般式

$$(X)_{n} = \begin{bmatrix} R_{3} & R_{4} \\ 1 & 1 \\ C & C & C & CONH \\ 1 & 1 \\ R_{1} & R_{2} \end{bmatrix}$$

(式中の R₁,R₂,R₃,R₄,R₅,X,n およびアルキレンは前記と同じ意味をもつ)

で表わされる芳香族アミドカルポン酸またはそ のエステルまたはその塩の製造方法。

または分枝状のアルキレン基であり、R₅ は水素原子または炭化水素基、置換炭化水素基および環状エーテル基の中から選ばれるカルボキシル基の保護基である)

で表わされる脂肪族カルポン酸またはそのエステルとを反応させ、次いで常法に従いカルポキシル基の保護基を脱離させ、さらに所望に応じその 生成物を塩に変えることを特徴とする

一般式

$$(X)_{n} = \begin{cases} R_{3} & R_{4} \\ 1 & 1 \\ C - C - CONH \\ 1 & 1 \\ R_{1} & R_{2} \end{cases}$$

$$(\Pi')$$

$$(-7n + V) - COOH$$

(式中の R₁,R₂,R₃,R₄,X.n およびアルキレン は前記と同じ意味をもつ)

で表わされる芳香族アミドカルポン酸またはそ の塩の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は楽理作用を有する新規な芳香族アミド カルボン酸誘導体の製造方法に関するものである。

(式中のR」とR2はそれぞれ水素原子または低級アルキル基であり、R3とR4はそれぞれ水紫原子または低級アルキル基であるか、あるいは両子で化学結合を形成するものであり、×は四分が大の低級アルカキン基、直鎖状では分枝状の低級アルキル、低級アルケニルオキンをは低級アルケニルオキンをは近級アルケニルオーンを成であり、Yは水素原子またはアルカリ金属であり、nは零または1~3の低級アルケニルオーンをであり、Xが2個の低級アルキル、低級アルケニルがであり、Xが2個の低級アルキル、低級アルケニル、低級アルウニルはである場合は両者が結合して環を形成することができる)

で表わされる芳香族アミド誘導体と、一般式 z - アルキレン - COOR₅ (II) (式中の Z は酸残基であり、アルキレンは直鎖状

これまで抗原抗体反応により惹起されるケミカルメジェーターの遊離を抑制する抗アレルギー剤としてはジソジウムクロモグリケートが知られているが、このもの経口投与では全く薬効が期待できないため、その利用分野に制限があつた。したがつて経口投与によつても十分治療効果を発揮できる医薬品の出現がこの分野における重要な課題となっていた。

本発明により得られる新規な芳香族アミドカルボン酸誘導体は経口投与によりアレルギー性疾患を治療しりる有用な化合物である。

本発明の目的化合物は、一般式

$$(X)_{n} = \begin{bmatrix} R_{3} & R_{4} & & & \\ I & I & \\ C & -C & -CONH & \\ I & I & \\ R_{1} & R_{2} & & \\ \end{bmatrix}$$

(式中の R_1 と R_2 はそれぞれ水素原子または低級 アルキル基、 R_3 と R_4 はそれぞれ水素原子または 低級アルキル基であるか、あるいは両者で化学結合 を形成するものであり、 R_5 は水素原子または炭化 水岩基、置換炭化水岩基および環状エーテル基の中から選ばれるカルボキシル基の保護基であり、
X はハロゲン原子、水酸基、低級アシルオキシ港、
直鎖状または分枝状の低級アルキル、低級アルクニルオキ
シ 基あるいは環状アルキル基であり、 N は零また
は 1~3の整数であり、 X が2 個の低級アルキル
低級アルケニル、低級アルコキシまたは低級アルケニル
低級アルケニル、低級アルコキシまたは
低級アルケニル
低級アルカニル
低級アルカニンは
のの低級アルカテル
が2 個のである)

で表わされる芳香族アミドカルボン酸、そのエステルまたはその塩であり、これらはいずれも文献未載の新規化合物である。

本発明に従えば、

一般式

$$(x)_{n} = \begin{cases} R_{3} & R_{4} \\ 1 & 1 \\ c - c - c - conh \\ 1 & 1 \\ R_{1} & R_{2} \end{cases}$$
 (I)

- 6 -

ロゲン化水素酸、スルホン酸、硫酸などのような酸の残菇で置換されたアルカン酸またはそのエステルが用いられるが、これらはいずれも既知の化合物であり、既知方法により製造することができる。ハロゲン化水素酸残基としては、塩素、臭素、ヨウ素などがあるが、特にヨウ素が好ましい。また、スルホン酸残基としては、ペンゼンスルホン酸やパラトルエンスルホン酸の残基がある。

で表わされる脂肪族カルボン酸またはそのエステルとを反応させ、所望に応じ常法を用いてカルボキシル基の保護 基を脱離させ、またその生成物を塩に変えることにより、目的化合物を得ること

本発明において出発原料として用いられる前記 一般式(I)の芳香族アミド誘導体は新規化合物で あり、たとえば一般式

ができる。

$$(x)_{n} = \begin{cases} R_{3} & R_{4} \\ 1 & 1 \\ C - C - COOH \\ 1 & 1 \\ R_{1} & R_{2} \end{cases}$$

(式中のR₁,R₂,R₃,R₄,X およぴ n は前記と同じ 意味をもつ)

で表わされる芳香族カルボン酸またはその反応 性官能的誘導体と、一般式

- 8 -

物を酸、塩基で処理し、必要あればエスチル悲を 常法に従つて除去し、塩酸で酸性とし析出した結 晶をロ取し適当な有機溶媒から再結晶し目的物を 得る。

本発明方法においては、一般式(1)で表わされる出発原料中のYが水素原子であるものの代りに、Yがアルカリ金属のものすなわちフェノラートを用いることができる。このフェノラートは反応中に生成させてもよい。

本発明の目的化合物の中のヒドロケイ皮酸誘導 体、すなわち一般式

(式中のR₁,R₂,R₅, X , n およびアルキレンは 前記と同じ意味をもつ)

で表わされる化合物を製造する場合は、対応する 出発原料を用いて直接に製造してもよいし、また 最初に対応するケイ皮酸誘導体、すなわち一般式

$$(x)_n$$
 $C = C - CONH$
 $C = C - CON$

(式中R₁,R₂,R₅, X, nおよびアルキレンは前 記と同じ意味をもつう

で表わされる化合物を製造し、次いでこれを還元 してもよい。

得られた化合物 (II)のカルポキシ基は常法に従 い医薬品として許容できる塩とすることができる。 たとえば、化合物(Ⅱ)のアルコール溶液にこれと 当量のカセイソーダの水溶液を加え適当な時間加 温することにより、容易にナトリウム塩とするこ とができる。また、一般式(1)のエステルを出発 原料として用いるときはその加水分解の操作によ り塩をつくることができる。

本発明によつて得られる芳香族アミド誘導体は 抗原抗体反応によつて惹起される効果に対して特 別の作用を有している。すなわち、アレルギーに 起因する疾患の治療薬として広く使用することが できる。

このようにして得た2-(31.41-ジメトキシ シンナモイルアミノ) フエノキシ酢 酸をアルコー ル溶液に溶解し、これと当量の水酸化ナトリウム を加える0分間加温する。減圧下で機縮し、残留 物にエタノールを加え溶解しこれにエーテルを加 え、析出する結晶を口取し2-(31,41-ジメト. キシシンナモイルアミノ)フエノキシ酢 酸のナト リウム塩を得る。

灾 施例 3

前記参考例で得た化合物を原料として用い、前 記名実施例と同様の操作により、以下の化合物を 製造することができた。

$$(x)_{n} = \begin{bmatrix} R_{3} & R_{4} \\ I & I \\ C & -C & -C & 0 & N & H \\ I & I & I \\ R_{1} & R_{2} & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & \\$$

特別 昭51-1439 (10)

次に災施例によつて本発明をさらに詳細に説明 する。なお、各実施例中における生成物の融点は いずれも未補正である。

参考例

ジオキサン100g とピリジン10g との混合 物中に、3,4-ジメトキシケイ皮酸クロリド2.3 まと3-アミノフエノール1.1gとを加え、2時 間加熱遺流させる。次いで反応混合物を減圧下に 濃縮し、残留物を少量のエタノールに密かして氷 水中に注ぎ、塩酸により酸性にすると、結晶が析 出してくる。これを口別し、エタノールと水の混 合物より再結晶させることにより、融点211~ 2 1 4 C O N - (3 - ヒドロキシフエニル) -3′,4′-ジメトキシケイ皮酸アミド1.88を得た。 同じようにして、対応する出発原料を用い次の 化合物を製造するととができた。

$$(x)_{n} \xrightarrow{3'} \begin{bmatrix} R_{3} & R_{4} \\ 1 & 1 \\ C & C & C & C & CONH \\ 1 & 1 & 1 \\ 6R_{1} & R_{2} & 6 & 5 & OH \end{bmatrix}$$

-14-

		R,	R ₂	R ₃ ,	R.	アルキレン	結合位置	融 点(で)	再結晶溶媒
1	X	:-	2						
2	3'-OM e , 4'-OM e	н	н	結	台	-CH ₂ -	3	160~165	含水アルコール
2	3'-OMe,4'-OMe	Me	н	結	合	#	4	165~168	含水アルコール
2	3'-OMe,4'-O-n-Pr	н	н	結	合		2	96~ 99	含水アルコール
1	4′ – i – P r	н	н	結	合	<i>u</i> .	2	148~152	含水アルコール
1	4′ -M e	н	Н	н,	н	<i>II</i>	4	188~189	含水アルコール
1	2'-C	Н	н	結	合	п	2	182~187	含水アルコール
2	3,41-メチレンジオキシ	н	Мe	結	合	"	4	167~170	含水アルコール
1	4'-シクロヘキシル	Н	н	結	合	"	4	224~226	含水アルコール
2	3:4'-トリメチレン	н	Н	結	合	"	4	190~195	含水アルコール
· 2	3'-OMe,4'-OMe	н	н	н,	н	"	.2	117~120	含水アルコール
3	2,4,5/-トリメトキシ	н	н	結	合	"	4	213~218	含水アルコール
1	4'-OCH2C(Me)=CH2	н	Н	結	台	11	4 '	197~199	含水アルコール
1	4'-OCH2CH=CH2	Н	н	結	合	"	4	213~216	含水アルコール
2	3'-CH2CH=CH2 , 4'-OMe	н	н	結	合	"	4	197~201	含水アルコール
2	3'-CH2C(Me)=CH2 . 4'-OMe	н	Н	結	合	"	4	157~160	含水アルコール
0	_	н	Н	結	台	"	4	185~190	含水アルコール
1	4'-C1	Me	Η٠	結	合	"	4	215~217	含水アルコール
1	4'-OM e	Me	н	結	合	"	4	177~179	含水アルコール
2	4'-OCOCH ₃ , 3'-OMe	н	Н	結	合		3	95~ 97	含水アルコール
2	3'-OMe, 4'-OMe	Н	н	結	合	-(CH ₂) ₃ -	4	185~190	含水アルニール
1	4'-Me	н	Н	結	台	-(CH ₂) ₅ -	4	173~176	含水アルコール
2	3'-OMe, 4'-OMe	Н	Н	結	合	-CH(CH3)-	3	198~203	含水アルコール
2	3'-OMe , 4'-OH	Н	н	結	台	-CH ₂ -	3	103~106	含水アルコール

手 続 補 正 書

Ħ 2 有市村門

英 雄

昭和49年 特許願 第43676号

2. 発明の名称:

芳香族アミドカルボン酸の製法

3. 福正をする者

事件との関係 特許出願人

所 長野県松本市芳川区野湖105番地

Æ

キッセイ薬品工業株式会社

代表者 神 沢 邦 堆

〒 104 東京都中央区銀座6丁目4番5号 土駅ビル5階

则·-升厚士 阿 形 亚 斯 (571)9920番雪

5. 福正命令の日付

自

6. 福正により増加する発明の数

7. 加正の対象

顧書の前記以外の発明者の關

-20-

8, 補正の内容

発明者中飯塚欣二および小林通洋の住所を 錯誤 により誤つて移転前の住所 を記載いたしましたの で、それぞれの住民票によりこれを証し、別紙訂 正願書のとおり訂正いたしますので、お認め下さい いますようお願いいたします。

9. 添付售類の目録

特願昭49-43675号の手続補正母に添付し 住 民 票(写) た分を援用する。

1通

(2) 訂正願書

特 許 願(4)(特許法第38条ただし) 6 前記以外の発明者

昭和49年 4 月 18日

特許庁長官斎藤英雄 殿

カロボノミドカル 特許請求の範囲に記載された発明の数 2. 発 明 当

長野県東第摩郡 本銀村大字横田 436 番地の1

張 角 群笠郎 (ほか7名)

4. 代 理

〒104 東京都中央区銀座6丁目4番5号 土星ビル5階

弁理士 阿 形 . 明

准 話 (571) 9 9 2 0 番

5. 添付書類の目録

明細書	1 通
图	1 通
願掛副本	1 通
委 任 状	1 通
11.665克米沙北地	1

乙门针焊

住居表示変更届

昭和50年8月2日

特許庁長官 斎 藤 英 雄 殿

1、事件の表示

昭和49年 特許廟 第43676号

2. 発明の名称

芳香族アミドカルポン酸の製法

3. 住居表示を変更した者

事件との関係 発明者

旧住居表示 長野県東第摩郡本郷村大字横田 436番地の1

新住居表示 長野県松本市大字横田 4 3 6 番地の 1

氏 名 强 前 辭兰郎

4. 手統をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 長野県松木市券州区東海口門 品地

氏 名 キッセイ薬品 CS 拟式会社 代表者 神 於 新 雄 段野県岡谷市湊10番地の4

死 菜 菱

愛知界名古屋市昭和区山花町19番地大菜荘6号

饭粮款兰

長野界松末市寿台2丁目9番2号

声曲道雄

長野県松本市大字島立1,712番地

米 学 蓉 蓉

長野県塩尻市大字広丘吉田 2,525番地

上条哲質

艮野県松本市芫ଟ3丁目8番10号電管推

小 採 随 聲

長野県松本市大字寿白瀬淵 681 番地83

在 麗 盤 一

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

□ OTHER: _____